

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年:2014年～2018年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
特殊ガス企画委員会

単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2014年 (平成26年)		2015年 (平成27年)		2016年 (平成28年)		2017年 (平成29年)		2018年 (平成30年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルシン	AsH3	9,800	91%	11,800	120%	11,200	95%	10,200	91%	9,600	94%
2	ジボラン	B2H6	390	57%	360	92%	450	125%	360	80%	490	136%
3	三塩化ホウ素	BCl3	126,700	123%	145,800	115%	146,300	100%	171,000	117%	160,000	94%
4	四フッ化炭素	CF4	565,200	113%	535,300	95%	631,800	118%	658,600	104%	656,500	100%
5	三フッ化メタン	CHF3	84,900	102%	97,200	114%	93,500	96%	94,100	101%	96,900	103%
6	六フッ化エタン	C2F6	131,800	75%	169,500	129%	178,400	105%	205,900	115%	179,100	87%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	65,000	116%	51,500	79%	83,700	163%	121,600	145%	185,000	152%
8	塩素	Cl2	307,100	112%	352,000	115%	356,200	101%	389,300	109%	357,500	92%
9	ゲルマン	GeH4	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%	240	100%
10	臭化水素	HBr	125,400	137%	157,300	125%	164,400	105%	165,800	101%	151,200	91%
11	アンモニア	NH3	3,442,600	118%	3,697,000	107%	3,522,700	95%	3,145,400	89%	2,901,200	92%
12	三フッ化窒素	NF3	1,717,600	101%	1,817,400	106%	1,634,000	90%	1,309,100	80%	1,665,200	127%
13	一酸化二窒素	N2O	992,500	104%	1,129,200	114%	1,219,500	108%	1,176,200	96%	1,029,800	88%
14	ホスフィン	PH3	8,300	104%	6,700	81%	6,900	103%	7,400	107%	7,500	101%
15	モノシラン	SiH4	424,700	114%	398,200	94%	316,400	79%	305,600	97%	348,000	114%
16	ジクロロシラン	SiH2Cl2	172,800	67%	239,300	138%	187,600	78%	166,700	89%	200,200	120%
17	四フッ化ケイ素	SiF4	5,400	100%	5,400	100%	6,500	120%	7,000	108%	7,000	100%
18	TEOS	(C2H5O)4Si	421,900	111%	441,800	105%	490,500	111%	614,800	125%	751,800	122%
19	六フッ化硫黄	SF6	211,000	88%	208,000	99%	210,000	101%	215,000	102%	215,000	100%
20	六フッ化タンゲステン	WF6	105,000	111%	115,000	110%	121,000	105%	185,000	153%	230,000	124%
21	有機金属		2,090	93%	2,510	120%	2,100	84%	2,200	105%	1,900	86%